解 説

# ナノワイヤーの熱電特性の評価

長谷川 靖洋, 大塚 美緒子, 有坂 太一

埼玉大学 大学院 理工学研究科

(受取日:2017年4月19日,受理日:2017年5月17日)

## **Measurement Techniques of Thermoelectrics Properties for Nanowire**

## Yasuhiro Hasegawa, Mioko Otsuka, and Taichi Arisaka

## Graduated School of Science and Engineering, Saitama University

(Received Apr. 19, 2017; Accepted May 17, 2017)

We have developed measurement techniques of thermoelectric properties for Bi nanowire encased in quartz based on the measurement for bulk thermoelectric materials. Though internal impedance of the nanowire would be increased due to its narrower wire diameter, 4-wire probe measurement has been required to obtain the proper evaluation. Therefore, nano-fabrication techniques using dual focused-ion-beam apparatus have also developed to make suitable electrical contact on the side of the nanowire locally. As a result, we are able to introduce 4-wire probe measurement for the nanowire to estimate the physical properties in generalized Ohm's law even if internal impedance of the nanowire is large.

Keywords: Thermoelectric properties, Seebeck coefficient, resistivity, thermal conductivity, generalized Ohm's law, nano fabrication



右より 長谷川 靖洋, Yasuhiro Hasegawa, E-mail: hasegawa@mail.saitama-u.ac.jp 有坂 太一, Taichi Arisaka, E-mail: arisaka@env.saitama-u.ac.jp 大塚 美緒子, Mioko Otsuka, E-mail: piyopiyo.mioko@env.saitama-u.ac.jp

#### 1. はじめに

材料両端の温度差から起電力を発生するゼーベック効果 は熱電対の動作原理として知られており、その現象自体は 幅広く認知されている。また、材料に電流を流すことによ って温度差が発生するペルチェ効果は、最近ではコンビニ エンスストアでのデザート温度管理などで利用されるよう になってきており、想像以上に生活の身近な部分で活躍し ている。対となるゼーベック効果ならびにペルチェ効果は、 温度差と電圧(熱起電力)を可逆的に変換可能であること から、総称して熱電効果もしくは熱電変換と言われている。 熱電対はあくまで温度センサーとして用いられているため、 温度差から電力への直接エネルギー変換材料には十分でな いが、電力発生を想定した材料は熱電変換材料と呼ばれて いる。室温領域でエネルギー変換効率が高い BiTe 系の材料 が現在幅広く用いられており、実用化されているほぼ唯一 の材料とも言える。<sup>1)</sup>

熱電変換材料のエネルギー変換効率は,一次元定常熱伝 導方程式を元に導出され,4 つの物理量からなる無次元性 能指数*ZT*と呼ばれる量を用いて表現される。<sup>1)</sup>

$$ZT = \frac{S^2}{\rho\kappa}T$$
(1)

ここで, S: ゼーベック係数 [VK<sup>-1</sup>], ρ. 抵抗率 [Ωm], κ. 熱伝導率 [W m<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>], T: 絶対温度 [K]となる。基本的に ZT が大きければ大きいほどエネルギー変換効率が高い材 料といえ, BiTe 系材料の場合,  $S \sim \pm 200 \,\mu V \, \text{K}^{-1}$ ,  $\rho \sim 10^{-5} \, \Omega \text{m}$ , *κ*~1.5 W m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>程度の大きさを持ち,室温(300 K)では ZT~1 程度の大きさを持つ。抵抗率 ρは、地球上で最も大 きく変化する物理量であり幅広く知られており、熱測定で はおなじみの熱伝導率 κに加えて,熱電変換材料において は単位温度差あたりの熱起電力であるゼーベック係数 Sを 取り扱う必要がある。ゼーベック係数になじみのない方に とっては、p型,n型のBiTe 系材のゼーベック係数がそれ ぞれ±200 μV K<sup>-1</sup>と極めて小さいと感じるかも知れないが, 実際の熱回収の例では温度差 100 K として, N=100 個ほど の熱電変換材料を直列に接続することで、 $S \times \Delta T \times N = 200$  $\mu V K^{-1} \times 100 K \times 100 = 2 \times 10^{6} \mu V = 2 V 程度の出力電圧が期$ 待できる。その意味では、熱電変換によるエネルギー変換 出力は低電圧であるものの,数A程度の大電流が得られ, 結果として数W程度の電力が得られる。

無次元性能指数である ZT を構成する各物理量を明確に 評価する必要があることは言うまでも無いが、正しく評価 することが想像以上に難しい。熱伝導率 κを正しく評価す ることが如何に難しいかを熟知されている熱測定の読者の 皆さんなら感覚的に納得していただけるだろう。抵抗率 ρ の評価は、オーソドックスで基本4端子法に従えば良いは ずである。ただし、測定対象の熱電変換材料もしくは熱電 変換素子のインピーダンスの大きさによって取り得る対応 が異なってくる。例えば、数mm角のバルク状 BiTe 系材料 であれば、予想される内部インピーダンス(内部抵抗)は 数十 mΩと予想され,接触抵抗が無視できないことから,2 端子法ではなく,4 端子法の測定が求められている。ただ し, 直径 100 nm, 長さ1 mm というような高アスペクト比 をもつナノワイヤー形状では, 0.1~1 MΩクラスになるこ ともあり、ジョンソンノイズとの兼ね合いで測定には大き な困難を有する場合もある。2)

本稿では、一般的な熱電変換材料の評価を紹介した上で、 著者らが研究対象としているナノワイヤー形状の熱電変換 材料の測定法についての解説をまとめておく。

#### 2. バルク状熱電変換材料特性評価

実際の熱回収や、ペルチェ冷却などに用いられている数 mm 程度大きさを持つバルク状熱電変換材料の特性評価に は、専用の測定装置が市販されている。多くの方々がこれ らを利用しているもの事実である。その一方、それぞれの 特性に合わせた測定システムを構築して行かなければなら ないこともある。例えば、ゼーベック係数について考えて みる。電場 *E* とゼーベック効果の関係より

$$\boldsymbol{E} = S \nabla T$$

と示され、簡単のために一次元の話に限定すると、ゼーベ ック係数Sはスカラー量となり、積分することによって  $V_S = S\Delta T$  (3)

(2)

。 となる。ここで温度差  $\Delta T$ [K]によって発生した熱起電力が  $V_{s}$ [V]となる。つまり、ゼーベック係数 S を求めるためには 式(3)より、

$$S = \frac{V_S}{\Delta T} \tag{4}$$

とかけ、熱電変換材料に温度差  $\Delta T$  を与え、それによって 得られた熱起電力  $V_s$ より決定される。極めて原理的な話で はあるのであるが、ゼーベック係数測定の難儀なことは、 比較的簡単に測定できてしまうことにある。もちろん、 $V_s$ はデジタルマルチメータで、温度差  $\Delta T$  は熱電対とデジタ ルマルチメータを使えば一見全く問題なさそうに思われる が、Fig.1 のような測定手法を考えてみる。直方体形状熱電 変換材料の片側にヒーターを取り付け通電することで温度 差を与え、側面に熱電対を取り付けることで温度差  $\Delta T$ (= $T_A$ - $T_B$ )を測定することが可能になる。取り付けられた 電極、もしくは熱電対の片側の材料を用いることで熱起電 力 $V_s = V_4$ -Vを測定することができる。事実、多くのゼー ベック係数測定は、Fig.1 のような形状で行われているので あるが、ここには様々な仮定がある。つまり、

- 1) 熱流は1次元で表される
- 2) 熱電対で測定した温度は熱電変換材料の表面温度であ
- り、内部も均一である。
- 3) 熱電対を通した熱損失がない
- 4) 熱電材料表面からの熱輻射は無視できる

などである。



**Fig.1** Schematic diagram for Seebeck coefficient measurement of general bulk thermoelectric material. T.C. means thermocouples.

1),2)を満たすために、比較的アスペクト比が大きな形 状を選び、またヒーターからの熱流を均一化するために、 熱電変換材料の両端に熱容量の大きな金属電極を取り付け るなどの対策が採られている。3)については注意が必要と なる。ヒーターで発生した熱のほぼ全てが熱電変換材料を

通過することが理想的であり,熱電対を取り付けることで 熱流を大きく変えないことが求められる。つまり、熱電対 の熱容量が大きな(太い)場合は、熱電対自身が大きな熱 損失の原因となり、熱電対の起電力が熱電変換材料表面温 度を正しく示しているか,充分な検討が必要となる。また, Fig.1 では2つの別々熱電対を利用しているため、補償温度 が一致しているか、等温状態では同じ温度を示すかなども 検討が必要となる。特に熱電対を用いる場合は、補償導線 を用いることが通例ではあるが,温度補償については使用 している温度測定装置に任せていることが多々ある。一般 的な温度測定装置においては真の値と比較して 0.5 K 程度 の差は問題にはならないだろう。2 つの熱電対から得られ た温度差 ΔT が 10 K 程度であれば問題ないものの,もし ΔT~1K程度の温度差を議論するのであれば、この手法は 大きな誤差を招くことになる。しかし、得られた温度差に ついての検討手法がほとんど無いことが大きな問題となる。 以上の検討項目は実は熱伝導率測定と同じとなり、ゼー ベック係数は一見測定が簡単に思われるかも知れないが, 正しいゼーベック係数測定が可能であることは、実効的に 熱伝導率測定も可能であること意味している。現在は, NIST より BiTe 系材料を用いたゼーベック係数の標準サン プルが供給されていることもあり、測定系の確認が出来 る。<sup>3)</sup>

我々がゼーベック係数測定を行う場合は, Fig.2 のような 差動熱電対を用いた温度差測定を行っている。





ただし、その温度は熱電変換材料の両端に取り付けた銅 電極上の温度測定ならびに熱起電力測定を行っている。<sup>4)</sup> 差動熱電対は、温度差を直接得るには非常に強力な手法で あるものの、片側を電気的に絶縁する必要があるだけでな く,他の1箇所で絶対温度測定する必要がある。この絶対 温度についても精密な温度制御が求められる。また、得ら れる温度差については銅-コンスタンタン差動熱電対では 室温領域で1Kあたり約40 µVとなり、昨今の高感度デジ タルマルチメータでは問題なく測定できる。Fig.2 に示した ヒーターと差動熱電対とを PID 制御することで適切な測定 系では1 mK 以下の安定性で制御できるなどの利点が挙げ られる。このように差動熱電対の利用は面倒ではあるもの の、高い確度で正確な温度測定が可能であることが大きな 利点である。その熱電対直径を小さくすることで、熱応答 性をできるだけ高くすることもできるため, 我々は通常直 径 25 µm の銅-コンスタンタン差動熱電対を2%の銀入り ハンダで自作している。ゼーベック係数測定時に同時に熱 伝導率測定を行うことで、熱損失の割合などを評価するな ど、できるだけ得られたゼーベック係数を検証することを お勧めする。また,熱電対も含めて数µV の電圧を測定す る際は,補償導線に頼るだけでなく,電極や端子接続する 際は,必ず数µV 以下のコンタクト電圧が発生することな どを想定した上で,低接触電位スイッチング回路によるコ ンタクト電圧の除去などを積極的に行った上での測定が求 められる。<sup>2)</sup>

先にも少し触れたが,抵抗率測定についても注意すべき 点がある。電流 I を熱電変換材料に印加し,その電圧降下 分から抵抗率を求める際,電流密度を J [A/m<sup>2</sup>]とすると一 次元の基本方程式は

$$E = \rho J + S \nabla T$$

(5)

(6)

となる。ここで何故先ほど出てきたゼーベック効果に関す る項が入っているかというと、電流 I を流すことによって ペルチェ効果が発生し、その結果として熱電変換材料の両 端に温度勾配が発生する。もちろん、その大きさが無視で きる量であれば問題ないが、積分することで

$$V_{P} = RI + S\Delta T$$

よなり, *RI* >> SΔT の条件が成立しているかの検証が必要となる。といえ、先ほどのゼーベック測定と異なり、ここで発生する温度勾配、温度差は制御できる量ではないので、 1) 温度勾配が発生する前に抵抗測定を終了する 2) 温度勾配が発生することを前提に解析を行う

3) 交流法を用いて測定する

などが現実的な測定手法であると考えられる。熱と電気の 流れについては、その特徴的な時間スケールが大きく異な ることから、電流だけ流して熱流は流れないようにするこ とが可能となる。一般的なバルク材料の場合、1 kHz 程度 までの電気応答性はあると考えられ、それ以上は測定する 回路の浮遊容量の関係で不明瞭になる。また、熱電変換材 料の特徴的な熱応答性  $\omega$  [rad s<sup>-1</sup>]については、熱拡散率を  $\alpha$  [m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>]、長さを L [m]とすると、

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{\alpha}{\left(\frac{L}{2}\right)^2} \tag{7}$$

と表すことできる。<sup>4,5)</sup> 一般的な熱電変換材料の熱拡散率  $\alpha$ は  $10^6 \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$ のオーダーであり, L=2 mm とすると,特徴的 な熱周波数  $f_c$  は 0.16 Hz となる。つまり,  $10 f_c$ 以上の特徴 的な周波数,例えば、1 s 以下の時間スケールで定常電流を 印加し,抵抗に対応する電圧を測定することで、1)の条件 を満たすことが出来る。もちろん、熱電変換材料の形状に よって、予想される抵抗値が 1  $\Omega$ 以下であれば、Fig.3 のよ うな 4 端子測定が基本となる。



**Fig.3** Schematic diagram for resistance measurement by 4-wire method of general bulk thermoelectric material.

式(6)の第2項の影響を完全に無視したい場合は,DCデルタ法と呼ばれる数 Hz のタイミングで矩形波電流を正方向ならびに逆方向に流し、そこからオフセット電圧を除去する方法が採られている。<sup>2)</sup>2)については、定常電流を

#### Netsu Sokutei 44 (3) 2017

流し,特徴的な熱の時間が十分経過した後に(>10/f<sub>c</sub>),オ フセット電圧が重畳したことを確認した上で,純粋な抵抗 成分だけを取り出す方法がある。ただし,この手法では, 何を以て熱的に安定したかなど経験値に頼る部分があるた め,あまりお勧めできない。このため,1)をさらに拡張し た交流電流を印加し,ロックインアンプなどで抵抗に関す る起電力を測定する手法が3)がとして挙げられる。ロッ クインアンプを使用することで,S/N比が良く,正確な測 定が可能となるため,非常に大きな利点がある。ただし, 印加する周波数が大きすぎると,測定回路の浮遊容量など も同時に検知し,虚数成分が大きくなることなども考え, 適切な周波数の選択が必要となる。一般的には10f<sub>c</sub>以上の 周波数を選択することになる。<sup>4,5)</sup>

熱伝導率 κについては、理想的な熱回路での測定を行う ことが出来れば、ゼーベック係数と同時に測定可能である。 しかし電気絶縁と異なり、完全な熱絶縁は困難であること から、予想される熱電変換材料のコンダクタンスを考慮し た上での電極リード線の選択が必須である。Fig.2 に示した ように、熱電変換材料両端で温度差を得るためにヒーター を設置するが、電流リード線は細すぎるとそれ自体がヒー ターに、太すぎると熱損失源になるため、細さ・長さ共に 充分な見積もりが必要となる。もしくは、電流リード線か らの熱損失を最大限に減らすために、Fig.4 にように、温度 制御された熱アンカーを設置することが現実的と言える。



**Fig.4** Schematic diagram for Seebeck coefficient and thermal conductivity measurement by thermal anchor. T. C. means thermocouples.

最近では、ソフトウエア的に PID 温度制御も可能である ため、測定対象部の高温側と熱アンカー部の高温側を同じ 温度  $T_A$ にフィードバック制御し、熱電信号線だけでなく、 ヒーターへの信号線などすべてを熱アンカーに設置するこ とで、測定対象部からの熱流出を抑えることができる。こ の際、リード線を通した全体の熱コンダクタンスと、測定 サンプルの熱コンダクタンスを予め計算した上で、測定サ ンプルの形状を決定することが必要となる。

とはいえ、一般的な熱電変換材料においては、ゼーベッ ク係数と抵抗率は同じサンプルで測定し、熱伝導率につい ては異なるサンプルを用いてレーザーフラッシュ法で測定 した上で無次元性能指数 ZT を評価することか多いのが実 状である。多結晶体など、作製した材料の切り出し方によ って、その組成が大きく変わらないことが保証されるので あれば正しい評価法と言えるが、異方性が強い材料の単結 晶などの場合は、理想的には単一のサンプルで全ての物性 値を測定することが求められる。ここで外部磁場、温度勾 配がある場合、一般化されたオームの法則はベクトル表記 で **E** =  $\rho J$  +  $S \nabla T$  +  $R_H B \times J$  +  $NB \times \nabla T$  (8) とかけ,  $\nabla T = 0$  であれば一般的な測定手法でホール係数  $R_H$ [C m<sup>-3</sup>],  $\nabla T \neq 0$  であればネルンスト係数 N [V K<sup>-1</sup> T<sup>-1</sup>]など の測定も可能となる。ただし,式(8)では磁場を含み,ロー レンツ力が発生することから,少なくとも1次元の基本方 程式では記述しきれず,場合によって測定サンプルの形状 効果も考慮しないと正確な物性値が得られないなどの問題 も発生する。形状効果をできるだけ無視するためには,高 アスペクト比のサンプルを準備することが求められるが, サンプル長さL が大きくなると,式(7)より特徴的な熱周波

以上のように、バルク状の熱電変換材料を用いた場合で も考慮すべき点が多く、測定系については使用するサンプ ルの予想される物性値から逆算して、最適な形状ならびに 手法を適用することが求められる。

数が小さくなるため、測定条件を見直す必要がある。

バルク形状の熱電変換材料であっても、それ自身のイン ピーダンスが1Ω以下であれば、出来るだけ細い測定リー ド線と熱電対を用いた上で2端子法によるゼーベック係数、 熱伝導率測定、4端子法による抵抗率測定が基本となる。 最近では有機材料を含む新しい熱電変換材料の開発が行わ れており、π電子系の電気伝導を有するといえど無機材料 系よりインピーダンスが高い。また、著者らが開発を進め ている単一ナノワイヤー形状など、100 kΩ程度のインピー ダンスを持つ熱電特性の評価が必須であり、それぞれの材 料の特性に合わせて測定手法の開発も並行して求められて いる。

#### 3. ナノワイヤー熱電変換材料特性評価

#### 3.1 ナノワイヤー熱電変換素子の作製

一例として、ナノワイヤー熱電変換材料の評価法を挙げ ていく。ただし、ナノワイヤーといっても、扱っている材 料によっては、その直径や長さに大きな違いがある。例え ば、カーボンナノチューブでは合成法やその構造にも大き く依存するが、直径は0.4~100 nm 程度、長さは数十 nm~ 数 mm に及ぶものまで報告されている。本稿で取り扱うナ ノワイヤーは、半金属である Bi 製であり、有効質量が小さ いこともあり、移動度が高く、より大きなワイヤー直径で 量子閉じ込めを実現し、1 次元状態密度を導入しやすいと いわれている。その一つの目安となるのがワイヤー直径 200 nm であり、ワイヤー直径が 50 nm 程度になると 77 K において半金属-半導体遷移が起こることがモデル計算か ら報告されている。<sup>の</sup>

Bi 製のナノワイヤー熱電変換素子の作製法は、さまざま 報告されており、最も一般的なものはアルミニウムの陽極 酸化を用いたナノポーラスに液化した Bi を圧入する方法 である。この手法は幅広く用いられ、ワイヤー直径 6 nm ~ 200 nm のものが作製されている。しかしながら、抵抗率を 含む物性測定は極めて困難であり、ほとんどが抵抗値の報 告となっている。<sup>7-10)</sup>理由の一つとして、ナノポーラスの 長さが数~数十µm と短く、ゼーベック係数測定を行うに は充分な温度差が得られないことと、抵抗率測定を行う院 にも 2 端子測定では接触抵抗が無視できず、4 端子測定を 行うにもナノポーラスで覆われておりナノワイヤー表面へ の局所電極形成が困難であることなどが挙げられる。

我々は、これらの問題点を充分に理解した上で、全く新 しいナノワイヤー熱電変換素子の作製を進めている。ここ で、正しいゼーベック係数測定には有限な温度差、例えば ヒーターなどを用いて1 K 以上の温度差を得るためには1 mm 以上の長さが必要であること、抵抗測定やホール測定 を行うためには将来的に4 端子測定による物性測定ができ

ることなどの必要条件があった。もちろん、電子ビームリ ソグラフィー法で極薄 Bi 薄膜からナノワイヤーを形成す る手法は有益であるが,3次元形状から1次元形状につい て物性値の不連続性が生じ、量子効果導入による物性値の 変化かが不明瞭という問題あった。そのため、我々はマイ クロスケールからナノスケールへとワイヤー直径を段階的 に変化させる手法を採った。ここで、必要となるのが Bi ナノワイヤーの入れ物であるテンプレートである。先ほど 例に出したアルミナ陽極酸化によるナノポーラスも、一般 的にはアルミナテンプレートと呼ばれ、機械的強度に乏し いBiナノワイヤーを保持する役割を果たす。我々の手法に ついても、全く異なる材料を用いたテンプレートの作製か ら始まった。11) 重要な点は,量子効果を議論する際に,ナ ノワイヤー表面の波動関数が完全にゼロとなるという仮定 を用いているため、<sup>6</sup> 絶縁物である必要があり、最終的に 材料として石英ガラスを採用した。石英ガラスは光ファイ バーにも用いられていることもあり、線引き技術を用いる ことで、直径数um のポア径が得られることが知られてい た。そこで我々は、この技術を発展・最適化することで、 平成 29 年現在, 最小ポア径 25 nm, 長さ数 mm 以上の石英 ガラステンプレートの開発に成功している。

これによって、ナノワイヤー熱電変換素子の入れ物となるテンプレートの用意が出来たので、あとはこのポア径の中に、Biなどの熱電変換材料を入れれば良い。Biは融点が271 ℃と他の金属と比較しても低く、真空中に用意された石英ガラステンプレートを用意し、その後、希ガス中で液化した Biを圧入する圧入法を用いることで、Bi製ナノワイヤー熱電変換素子の作製が可能となる。固化する際の条件によって、単結晶化が可能となり、石英ガラステンプレートを用いていることもあり、石英ガラスを通して高輝度X線によるラウエ測定で長さ方向、ワイヤー直径方向の結晶方向の決定が可能となる。<sup>14)</sup>現在、Biだけでなく、フラックス法を用いて材料の融点を下げることによって、BiTe や Si ナノワイヤー熱電変換素子の作製も並行して行われていることを付け加えておく。

#### 3.2 測定準備

我々が取り扱っているナノワイヤー熱電変換素子(Fig.5) は、石英ガラステンプレート内に完全に封入されているた めに、ナノワイヤーでありながら取り扱いはバルク材料と 同じとなる。



**Fig.5** Schematic diagram of developing single crystal Bi thermoelectric nanowire element.

例えば、ゼーベック係数を測定したい場合は Fig.6 のように、ワイヤー端部に電極を取り付け、熱電対によってその温度差を、そして温度差に対応したナノワイヤーからの 熱起電力を測定すれば良い。



**Fig.6** ConFig.uration of Seebeck coefficient measurement for Bi thermoelectric nanowire element. T. C. means thermocouples.

また抵抗率についても、ワイヤー直径が小さければ、2 端子法で抵抗値を計測し、予め電子顕微鏡でワイヤー直径 が分かっていれば抵抗率を求めることが出来る。例えば、 ワイヤー直径を500 nm、長さを1 mm として、Bi の室温で の抵抗率  $\rho \ge 1.3 \mu\Omega$ とすると、期待される抵抗値は6.6 k $\Omega$ となり、2 端子法でも充分対応が可能となる。ただし、 これはほとんど接触抵抗が無視できる場合に限る。これま での経験から、つまり、Bi ナノワイヤー端部との電気接合 を如何に施すかが、極めて重要となる

Biナノワイヤー端部と電極とを電気接合する際,ハンダ などの接合材料が一つの候補となる。しかし, Bi はハンダ と共晶合金を形成することから(低温ハンダとして使われ ている),ゼーベック係数をはじめとする熱電物性が大きく 変化するため不向きとなる。また、銀ペーストなども候補 として挙げられるが、銀フィラーの大きさが数µm 以上と ワイヤー直径として比較して大きく、電気接合は困難とな る。<sup>16)</sup> このため、ワイヤー端部に金属電極膜を成膜し、 その後にハンダなどの接合材料を利用する。金属電極を成 膜する際, ワイヤー端部には平坦度が要求され, 我々はシ リカ系の研磨剤を利用して, 石英テンプレート共に Bi ワイ ヤー端部を研磨し、平坦度を保っている。16) ここで石英 ガラスは堅い材料であり、Bi は柔らかい材料であるため、 研磨条件によっては Bi 部分だけ選択的に削られることも あるため、その最適化が非常に重要な作業となる。また、 石英ガラスで構成されているワイヤー端部に研磨剤が静電 気力によって付着することもあるので、平坦度だけでなく 充分な洗浄が必要となる。

ナノワイヤー熱電変換素子の端部に金属電極膜を形成す る際,Biならびに石英ガラスとの密着性を考慮すると、チ タンならびにクロムなどの材料が候補材料としてあげられ、 さらにその後の電極接合などを考えると、銅もしくは金な どの材料を組み合わせて多層金属薄膜を形成する。ただし、 一般的な真空蒸着で金属薄膜を成膜すると、充分な密着性 が得られないなども問題もあり、我々はアルゴンプラズマ 中で金属イオンを印加し、ナノワイヤー熱電変換素子にバ イアスを印加する手法でクロム/銅もしくはチタン/銅など の2層薄膜を採用している(Fig.7)。

成膜の前に、アルゴンプラズマでBiナノワイヤー端部の 酸化膜層を除去することも良好な電気接続を得るために重 要な工程となる。

金属薄膜の形成によって、ナノワイヤー熱電変換素子は 通常のバルク素子と同じ取り扱いが出来るため、金属電極、 熱電対などを取り付ければ、熱電物性測定の準備が完了と なる。ただし、Fig.6に示した状態は、ゼーベック係数と抵

#### Netsu Sokutei 44 (3) 2017

解 説



**Fig.7** Cross section image between edge of Bi thermoelectric nanowire element and 2-layer thin film metal electrode.

抗率しか測定ができない。しかも,抵抗率は 2 端子法に よって行うので,ワイヤー端部との電気的接続が保証され ていない場合,ナノコンタクトの接触抵抗を測定している 可能性すらある。また,そのキャリア密度や移動度を測定 するためにはホール係数測定が必要であるし,散乱プロセ スを知るためにはネルンスト係数測定が必要である。その 意味では,ナノワイヤー端部だけでなく,基本的に Fig.8 に示すように,その表面(もしくは側面)にも電極形成が 必要となる。



**Fig.8** Schematic diagram of making local electrodes at side of Bi nanowire and secondary electron microscope image after nano-processing by focused ion beam.

薄膜などの2次元材料においては、電子ビームリソグラフィー法を用いてパターン形成・金属薄膜蒸着によって表面への電極形成が可能となり、InPやInAsなどのナノワイヤーにおいても同様の手法が採られている。<sup>17,18)</sup>しかしながら、Fig.4に示した我々が扱っているナノワイヤー熱電変換素子は石英ガラスで覆われていることもあり、しかも形状としては3次元スケールとなるため、電子ビームリソグラフィー法を用いることは困難となる。

そこで我々は、ワイヤー端部との電気的接続で培った研 磨スキルと集東イオンビームによるその場ナノ加工を組み 合わせた手法で、ナノワイヤー熱電変換素子表面もしくは 側面に局所電極を形成することを構築した。<sup>19,20)</sup> その行程 を Fig.9 に示す。

(1) 測定を試みナノワイヤー熱電変換素子を用意し,(2) その側面をワイヤーとの距離 1 µm 以下まで手動研磨に よって除去する。レーザー顕微鏡を用いることで,この距 離を正確にすることが出来る。(3)表面にクロム/銅電極膜 を成膜し(後に電極として利用)(4)電子ビームと Ga イオ ンビームが同時に利用できるデュアル集束イオンビーム (FUR)を用いて以下のナノ加工を実施する(Fig Q 下)(0)

(FIB)を用いて以下のナノ加工を実施する(Fig.9下)。(a) 石英ガラス中のワイヤー位置を特定するため、石英ガラス



**Fig.9** Nano-processing procedure for Bi thermoelectric nanowire element by focused ion beam.

をスパッタリングしながら電子顕微鏡観察を行うことで, Biとガラスとの二次電子放出率の違いにより, Bi ワイヤー を全く露出させずワイヤー位置を決定できる。(b) 予想さ れたワイヤー位置側面から数 nm ずつワイヤーに向かって 石英ガラスをスライスしていき, (c) ワイヤー側面が露出 した瞬間に(d) FIB-CVD による局所電極形成(炭素/タング ステン膜)を行い,さらにガラス上部の銅電極に配線する。 (e)反対側も同じ加工を施し、(f) 上部で 2 つの電極を分割 する。この後, (5) ワイヤーボンダーによる配線や外部ヒ ーターの取り付けを行うと、測定サンプルの完成となる。 ナノワイヤー熱電変換素子側面にホールバーを取り付ける だけで非常に複雑なプロセスとなる。その上で、適切な電 流を流した上での I-V 特性を得た上で完全オーミック接続 であることを確認することは極めて重要となる。<sup>21)</sup> しかし, Fig.6 で示したように2端子法によるゼーベック係数と抵抗 率のみならず、4 端子法による抵抗率測定、ホール係数・ ネルンスト係数測定を行うためには, Fig.s.8,9 に示したナ ノ加工を用いた測定準備が必要となる。特に、ワイヤー直 径が小さくなると、予想される抵抗値が数 MΩとなり、-般的なロックインアンプの入力インピーダンスと同じ程度 の値となる。このため、ナノワイヤー熱電変換素子自体の 実効的なインピーダンスを減らすために, Fig.8 中ある側面 電極の利用が必要となるだけでなく、測定されたゼーベッ ク係数の値が正しいのかなどクロスチェックにも利用でき る。

#### 3.3 熱電特性の測定

Fig.8 に示すように、ナノワイヤー熱電変換素子上に局所 電極が取り付けられれば、Eq.(8)に示された一般化された オームの法則の物性値を測定できる。測定の基本は、バル ク素子と同様の手法を用いればよいのであるが、ナノワイ ヤーとバルクとの最も大きな違いは、その内部インピーダ ンスである。温度によっても抵抗率が変化するだけでなく, ワイヤー直径が小さくなると量子化され, Bi のバンド構造 が離散化することで半金属-半導体遷移が起こると予想さ れている。計算モデルによると、バンドのオーバーラップ などはワイヤー直径 d の 2 乗に反比例するため, <sup>6)</sup> ワイ ヤー直径 100 nm 程度までは半金属特有のバンドオーバー ラップが予想される。ワイヤー直径が 100 nm 以下になると, 少しずつバンドオーバーラップが小さくなり, 300 K では ワイヤー直径 20 nm, 100 K ではワイヤー直径 50 nm で半導 体化すると予想される。それによって室温領域で 10<sup>18</sup> cm-3 程度であったキャリア密度が大きく減少し、結果として抵 抗率が上昇する可能性が示唆されている。ただし、この結

果についてはモデル計算からのアプローチであって,キャ リア密度の減少の実験的な報告はなされていない。

ここではナノワイヤー熱電変換素子が量子化され,結果 として実効的な抵抗率が大きく変化したと仮定した上で話 進めていく。Fig.10 に各抵抗率を仮定した際の,ワイヤー 長さを1 mm とした場合でのワイヤー直径と抵抗値の関係 を示す。



**Fig.10** Relationship between Bi thermoelectric nanowire element and resistance.

ナノワイヤーの直径が小さくなると、材料自体の熱容量 が小さくなることから、適切な電流を流した上で電圧測定 を行わないと、ナノワイヤー自体が発熱するだけでなく、 ナノワイヤーが焼き切れることもある。このため、電気抵 抗から温度係数を求め、どの程度発熱なしに測定が出来る かなどを確かめておく必要がある。<sup>21)</sup>

ナノワイヤー熱電変換素子の熱電特性を測定する際は, 高い内部インピーダンス・低電圧を扱う必要がある。例え ば,内部インピーダンスが1MΩの場合は,少なくとも1GΩ 程度の入力インピーダンスをもった測定装置が必要とな る。<sup>2)</sup>低電圧を測定可能なロックインアンプの場合,通常 の入力インピーダンスは10MΩであり,特別なアンプを取 り付けることで100MΩまで入力インピーダンスを上げる ことはできるものの,現実的な選択肢ではない。つまり, 非常に高い入力インピーダンスを持った測定では,残念な がらロックインアンプの利用は難しく,デジタルマルチメ ータを使った測定が求められる。

しかし、デジタルマルチメータも完璧な装置ではないの で、如何に小さな電圧を測定できるかが大きな鍵となる。 そこで、我々が実践している方法は、Fig.11 に示したデジ タルマルチメータを使った交流測定である。



**Fig.11** Schematic diagram of Seebeck coefficient measurement for high impedance sample by alternative current.

基本的な考えはロックインアンプと同じであるが、これ を実時間測定で行う。式(7)でも示したとおり、熱電変換材 料は一般的には 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>程度の熱拡散率 αを持ち, その 熱応答性は極めて遅い。ここに着目し、ゼーベック係数を 行う。例えば、長さ数 mm のナノワイヤー熱電変換素子で あるとすれば、特徴的な熱周波数より充分小さな周波数を 選ぶとすると、ヒーターに5mHz程度の非常に遅い交流電 流を流し、熱電対ならびにナノワイヤー熱電変換素子から の熱起電力をデジタルマルチメータで測定する。この際, 熱電対は差動熱電対を使うと、温度差に関する誤差が小さ くなる。また、ナノワイヤー熱電変換素子からの熱起電力 についても, S/N 比が充分取れるまでヒーター電流を調整 する。非常に遅い熱振動であるため、デジタルマルチメー タのサンプルリング速度でも交流電流のリアルタイム測定 が可能となり,入力熱周波数は入力電流の2倍であるから, デジタルマルチメータからのデータを解析することでゼー ベック係数を求めることが出来る。この手法はロックイン アンプと原理的に同じことをリアルタイム測定で行ってい るものの、1 mHz までの低い周波数に対応しているデジタ ルロックインアンプよりも電圧安定度が良いことと、測定 時間を短く出来ることが利点として挙げられる。また,我々 はこの手法を Bi バルク素子のネルンスト係数測定を行う 際に用いている。もちろん、ナノワイヤー熱電変換素子の ネルンスト係数測定にも利用可能であり、ゼーベック係数 測定と異なり、入力インピーダンスが小さいことから、ネ ルンスト係数の大きさにも依存するが、比較的測定は簡単 となる。

もちろん,先に挙げた手法は抵抗率測定にも適用可能となる。ただし,抵抗率測定については,Fig.9に挙げたナノワイヤー表面への局所電極間距離をFIBで調整・形成することで抵抗値を1/10から1/100程度まで小さくすることは比較的簡単となる(Fig.12)。



**Fig.12** Schematic diagram of Seebeck coefficient and resistance measurement by steady state method for Bi thermoelectric nanowire element.

測定の準備段階で如何にうまく局所電極を取り付けるか が大きな課題となる。もちろん、ホール係数測定について も同様なことがいえ、この場合はロックインアンプの利用 が可能となる。<sup>21)</sup> ゼーベック係数測定においても、適切 な局所電極を用いることで、実効的な内部インピーダンス を減らすことができ、Fig.5 に示したように、我々が取り扱 っているナノワイヤー熱電変換素子はそのほとんどが石英 ガラスで出来ていることから、その温度勾配は一定である と見なすことが出来る。これより、全体の温度差ΔT ならび に測定した電極間距離 Δx との関係からゼーベック係数を 定常法でも求めることは原理的に可能である。ただし、Δx 間で充分な熱起電力が得られることが大前提となる。

以上のように,適切なナノ加工を施してやることで,ナ ノワイヤーの熱電特性の評価は簡単になる。ただし,ナノ 加工にはそれなりの経験と時間が必要になるだろう。

#### 3.4 熱伝導率の測定

最後に熱伝導率測定について述べておく。Fig.5 に示すように、全体が石英ガラスに覆われており、ほぼ全ての熱流が石英ガラスを伝わることから、定常法による熱伝導率測定は困難である。最も現実的な熱伝導率測定としてあげられるのは、30法となる。<sup>22)</sup>このためには、Biナノワイヤー単体の断熱・宙空状態を作り出すために、石英ガラス中からBiナノワイヤーのみを取り出す必要がある。化学的に極めて安定な石英ガラスのみを除去し、Biワイヤーだけを取り出すプロセス技術の確立が必要となるが、Fig.13のように適切な化学プロセスを用いることで、試験的に宙空状態のBiマイクロワイヤーを形成できている。



Fig.13 Secondary electron microscope image of suspended Bi wire after proper wet etching process<sub>o</sub> Gold film was deposited on the glass template to protect the etching process<sub>o</sub> The Bi wire is suspended and observed from right side from quartz part to left side.

ただし、このプロセスは完全ではなく、Bi ワイヤー表面に 石英ガラスが析出しており、さらなるプロセス技術の構築 が必要となる。ただし、この問題を解決すれば、Fig.13 に 示したようなナノ加工技術を用いて宙空ワイヤー端部に局 所電極を形成することで、30 法による熱伝導率測定が可能 になると考えている。

#### まとめ

バルク熱電変換材料での熱電特性の評価法を元に、ナノ ワイヤーでの熱電特性,特に,Bi製ナノワイヤー熱電変換 素子の評価法についてまとめた。バルク熱電材料と異なり、 ナノワイヤー熱電変換素子では、ワイヤー直径が小さくな るとその内部インピーダンスが大きくなることから、接触 抵抗だけでなく、ナノ加工による適切な局所電極形成なら びに測定装置の選択が必要となる。現在、量子効果導入が 期待できる Bi 製ナノワイヤー熱電変換素子の作製とその 熱電特性の評価を進めており、1 次元状態密度の導入によ る巨大ゼーベック効果の実証に取り組んでいる。

#### 謝 辞

本研究の一部は、NEDO エネルギー・新技術先導プログ ラム、JSPS 科学研究費補助金の一部によって行われた。また、Biナノワイヤーのナノ加工については、産業技術総合 研究所の村田正行博士の尽力に感謝申し上げます。

### 文 献

- 日本セラミックス協会熱電学会(編集),熱電変換材料(環境調和型新材料シリーズ),日刊工業新聞社 (2005).
- 2) ケースレー社, 高感度測定ハンドブック (第6版).
- D. Nathan, W. Lowhorn, Z. Q. Wong-Ng, E. Lu, M. Thomas, M. Otani, N. Green, J. Dilley, and T. N. Sharp, *Tran, Appl. Phys. A* 96 (2009) 511.
- 4) R. Homma, Y. Hasegawa, H. Terakado, H. Morita, and T. Komine, *Jpn. J. Appl. Phys.* **54** (2015) 026602.
- M. Otsuka, H. Terakado, Y. Hasegawa, Md. Zahidul Islam, Georg Bastian, and Alexander Stuck, *Japan. J. Appl. Phys.* 55, 126601 (2016).
- 6) Y.-M. Lin, Xiangzhong Sun, and M. S. Dresselhaus, *Physical Review B*, Vol. 62, 4610 (2000).
- 7) K. Liu, C. L. Chien, P. C. Searson, and K. -Y. Zhang, *Phys. Rev. B* **58**, R14168 (1998).
- K. Hong, F. Y. Yang, K. Liu, D. H. Reich, P. C. Searson, C. L. Chien, F. F. Balakirev, and G. S. Boebinger, *J. Appl. Phys.* 85, 6184 (1999).
- J. Heremans, C. M. Thrush, Y. -M. Lin, S. Cronin, Z. Zhang, M. S. Dresselhaus, and J. F. Mansfield, *Phys. Rev. B* 61, 2921 (2000).
- 10) Y.-M. Lin, O. Rabin, S. B. Cronin, J. Y. Ying, and M. S. Dresselhaus, *App. Phys. Lett.* 81, 2403 (2002).
- 11) Y. Hasegawa, M. Murata, D Nakamura, T. Taguchi, S. Nakamura, and S. Nakamura, *J. Electro. Mater.* **38**, 944 (2009).
- 12) M. Murata, D. Nakamura, Y. Hasegawa, T. Komine, T. Taguchi, S. Nakamura, V. Jovovic, and J. P. Heremans, *Appl. Phys. Lett.* 94, 192104 (2009).
- 13) M. Otsuka, R. Homma, and Y. Hasegawa, J. Electro. Mater. 46, 2976 (2017).
- Y. Hasegawa, D. Nakamura, M. Murata, H. Yamamoto, T. Komine, T. Taguchi, and S. Nakamura, *J. Electro. Mater.* 40, 1005 (2011).
- 15) A. Suzuki, Y. Hasegawa, Y. Ishikawa, T. Komine, H. Morita, and H. Shirai, *Rev. Sci. Instum.* 76, 023907 (2005).
- 16) Y. Hasegawa, Y. Ishikawa, H. Shirai, H. Morita, A. Kurokouchi, K. Wada, T. Komine, and H. Nakamura, *Rev. Sci. Instum.* 76, 113902 (2005).
- 17) K. Storm, F. Halvardsson, M. Heurlin, D. Lindgren, A. Gustafsson, P. M. Wu, B. Monemar, and L. Samuelson, *Nature Nano.* **7**, 718 (2012).
- 18) Ch. Blömers, T. Grap, M. I. Lepsa, J. Moers, St. Trellenkamp, D. Grützmacher, H. Lüth, and Th. Schäpers, *Appl. Phys. Lett.* **101**, 152106 (2012).
- M. Murata, Y. Hasegawa, T. Komine, T. Kobayashi, Nanoscale Res. Lett. 2012, 7:505.
- 20) M. Murata, Y. Hasegawa, Nanoscale Res. Lett. 2013, 8:400.
- 21) M. Masayuki, Y. Atsushi, Y. Hasegawa, K. Takashi, *Nano Letters*, **17**, 110 (2017).
- 22) C. Dames and G. Chen, *Rev. Sci. Instum.* **76**, 124902 (2005).